Electron-Magnon Scattering and Magnetization Switching in Perpendicularly Magnetized Thin Films and Nanowires

A. Mihai, C. Beigné, A. Marty, L. Vila, P. Warin, Y. Samson, J.P. Attané

Lab. Nanostructures et Magnétisme CEA / Univ. Joseph Fourier Grenoble, France

Reversal process of FePt/MgO thin layers



Thin layer with perpendicular magnetization





PRL 96, (2006) 147204 ; PRL 93, (2004) 257203

Resistivity measurements on FePt(10nm)



Resistivity contributions



 ρ_{MMR}

Resistivity measurements



Electron-magnon scattering and resistivity

PHYSICAL REVIEW B 66, 024433 (2002)

Electron-magnon scattering and magnetic resistivity in 3*d* ferromagnets

B. Raquet,^{1,*} M. Viret,² E. Sondergard,² O. Cespedes,³ and R. Mamy⁴

¹Laboratoire National des Champs Magnétiques Pulsés (LNCMP), 143 Av. de Rangueil, 31432 Toulouse, France

²CEA, Saclay, Service de l'Etat Condensé, Orme des merisiers, 91191 Gif sur Yvette, France

³Physics Department, Trinity College, Dublin 2, Ireland

⁴Laboratoire de Physique de la Matière Condensée de Toulouse, 135 Av. de Rangueil, 31077 Toulouse, France (Received 26 November 2001; revised manuscript received 3 May 2002; published 25 July 2002)



For high fields : $\rho_{MMR} \propto -|B|$

Field dependance of the resistivity : $\rho \infty$ -|B|











 $\rho_{MMR}{\propto}B_{E}$ for large values of B_{E}

Linearity at the vicinity of zero field

Thin layers of 3d metals

 $B_E \sim B_{ext}$

• no linearity near B_{ext}=0

• AMR contribution, etc.



Thin FePt layers $B_F \sim B_{ext} + B_A$ linearity near B_{ext}=0 remanent magnetic configuration 0.8910 0.8900 0.8890 0.8880 -1 0 B(T)The sample being magnetically saturated,; the equation $\rho_{MMR} \propto B_{ext}$ Is still valid for B_{ext}<0

Temperature dependance

 $\rho_{MMR}(B)/\rho_{MMR}(B=0)$



Magnetization reversal and MMR variations



MMR and partially reversed states of magnetization



$$\rho_{MMR} = -\frac{M}{M_{S}}\alpha(T)B$$

 $\rho_{MMR}{\propto}M{\times}B$



 $\rho_{MMR} {\propto} M {\times} B$



 $\rho_{MMR} {\propto} M {\times} B$



 $\rho_{MMR}{\propto}M{\times}B$



Localizing a Domain Wall within a Nanowire using MMR

$\rho_{MMR} \propto M \times B$



- Basically similar to GMR in CIP spin-valves, but with a single layer
- $\rho_{MMR}{\propto} M{\times}B \rightarrow$ necessity of applying a field
- limited to relatively highly anisotropic materials

Magnetization reversal detection within a nanowire





MEB observation of nanowires 150 nm×3 µm FePt(10 nm)/MgO

Conclusions

$\rho_{MMR}{\propto}M{\times}B$

- \bullet low signals, especially in materials with low $\rm H_{\rm C}$
- \rightarrow Measurement technique restricted to fundamental studies
- usable whenever two domains of opposite magnetization coexist
- necessity to get rid of DW resistance to measure M using MMR
- necessity to take MMR into account when measuring DW resistances

Mihai et al., PRB 77, 060401(R) (2008)

Temperature effects

 $\rho_{MMR} \propto \frac{B_t}{D(T)^2} T ln(\frac{g\mu_B B_t}{kT}) \qquad \begin{cases} D = D_0 - D_1 T^2 - D_2 T^{\frac{5}{2}} \\ B_t = B_0 + B \text{ avec } B << B_0 = B_A + \mu_0 M_S \end{cases}$

$$\frac{\partial \rho_{MRP}(T)}{\partial B} \propto \frac{T}{D(T)^2} \left[\ln(T) - \ln(\frac{\mu_B B_0}{k}) - 1 - \frac{B}{B_0} + \frac{1}{2} \left(\frac{B^2}{B_0} \right) \right]$$



Temperature dependance



RESISTIVITY 40 microohms.cm

Bonus : spin-valve FePt/Pt/FePt



Interaction électrons magnons dans métaux 3d purs.



FIG. 4. Experimental high-field magnetic resistivity (open squares) and theoretical $\Delta \rho_{mag}(B)$ curves (solid lines) deduced from Eq. (7) for Fe_{80 nm}/MgO thin films with the band structure parameters listed in Table I and the magnon mass renormalization as only fitting parameters (see text). In the inset, the agreement between the experimental temperature dependence of the high-field MR slope (open circles) and the theoretical one (solid line).

$$\begin{split} &\Delta\rho(T,B) \approx \rho(T,B) - \rho(T,0) \propto \frac{BT}{D(T)^2} \ln\!\left(\frac{\mu_B B}{kT}\right), \\ & \left. \frac{\partial \Delta\rho_{\max}(T,B)}{\partial B} \right|_{B \gg \mu_0 Ms} \propto T(1+2d_1T^2) (\ln T+cte), \end{split}$$

Raquet et al.(Phys. Rev. B 66, 024433 (2002))

• Reprise du modèle de Raquet et al.

Idée: la bande « d » agit comme un piège avec une densité d'états forte dans laquelle les électrons « s » de conduction sont diffusés par l'intermédiaire des magnons

$$E(q) = Dq^2 + g\mu_B (B_{\text{int erne}} + B_A + B_D + \mu_0 M_S \sin^2 \theta_k)$$

Où :

•D est le terme de «raideur » de magnons,

•B est le champ extérieur appliqué, B_{int} est le champ interne

le dernier terme est la de désaimantation induite par les magnons

$$B_{\text{int}} = \mu_0 H + \mu_0 M_s = B + \mu_0 M_s$$
$$B_D = -\mu_0 M_s \qquad B_A = \mu_0 H_A$$

$$B_{t} = B_{\text{int erne}} + B_{A} + B_{D} + \mu_{0}M_{S}\sin^{2}\theta_{k}$$
$$\Delta\rho \propto \frac{B_{t}}{D(T)^{2}}T\ln(\frac{\mu_{B}B_{t}}{kT})$$

Cas des métaux 3d purs (Raquet et al.):

•Faible anisotropie

•Fort champ appliqué

Bt=B

Notre cas:

•Forte anisotropie

•Faible champ appliqué

$$B_t = B + B_A + \mu_0 M_S$$



Modèle interaction électronsmagnons rapporté à la mesure



• Variation de la pente MR(H) fonction de T

Cas de Raquet:

Développement linéaire autour

des grands champs appliqués

$$\frac{\partial \Delta \rho(T)}{\partial B} \propto T(1+2d_1T^2)[\ln(T)+cte]$$

Notre cas:

Développement linéaire autour du zéro du champ applique mais Bt est toujours grand à cause de B_{anisotropie}

$$\frac{\partial \Delta \rho(T)}{\partial B} \propto \frac{1}{D_0^2} T (1 + 2d_1 T^2) \left[\ln(T) - \ln(\frac{\mu_B B_t}{k}) - 1 - \frac{B}{B_t} + \frac{1}{2} \left(\frac{B^2}{B_t} \right) \right]$$

Détection renversement aimantation

- Difficile d'intégrer la contribution de MR de parois dans la détermination de l'aimantation
- Méthode limitée à des matériaux à forte anisotropie et épaisseur faible.

Conclusion

- Nous avons réussi à appliquer le modèle de Raquet *et al.* à des champs appliqués faibles dans le cas de matériaux à forte anisotropie
- Nous avons trouvé un nouveau moyen de de mesure d'aimantation dans des couches minces.